

文部科学省委託事業【ナノテクノロジープラットフォーム】

大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点

平成30年度 支援利用申込書

平成30年 4月 6日

大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点長 殿

「7. 利用負担金」で承認を受ける所属長が属する部署・研究室等までご記入願います。

支援利用申込者

所 属：ナノテクノロジープラットフォーム株式会社 開発事業部 開発1課

職 名：研究主任

氏 名：名野 太郎 (みよしの たろう)

名野

所在地：〒xxx-yyy
大阪府茨木市美穂ヶ丘 x 丁目 y-z

TEL：(06) xxxx-yyyy

FAX：(06) xxxx-zzzz

E-mail：exsample@...

年齢 36歳

記入例のように、漢字氏名の後ろに括弧書きでふりがなを入れても構いません。

下記のとおり貴ナノテクノロジー設備供用拠点を利用したいので申込みます。

記

1. 支援利用の課題名

NPF 有効利用に関する研究

課題の継続区分*) (新規 継続 発展 いずれかを○で囲って下さい) 枠内は記入不要

*)「継続」とは昨年度と同一の課題名での申込を指します。「発展」とは昨年度から課題名は異なるものの、課題内容が昨年度の申込時より発展した内容であることを指します。どちらも「11.共同利用者リスト」の研究不正防止の確認欄の手続きが一部簡略化できます。

2. 課題の目的 (詳細は別紙に記載の上提出)

支援利用申込書 B「研究の要約」欄に記載

3. 支援利用での希望 (○で囲って下さい)

- (1) プラットフォーム(複数選択可) : 微細加工 / 分子・物質合成
- (2) 支援利用による成果 : 公開 (成果公開事業) / 非公開 (成果非公開事業)

4. 希望する支援利用形態 (○で囲って下さい)

- (1) 機器利用
- (2) 技術代行
- (3) 技術補助
- (4) 共同研究
- (5) 技術相談

5. 利用の期間 (年度内)

平成30年 4月 6日 ~ 平成31年 3月 29日

6. 利用したい装置 (表1、表2から選んで装置番号を○で囲って下さい)

表 1A： 微細加工プラットフォーム支援提供装置 A 群

装置番号	設備(設備群)名	メーカー・機種
FA-01	高精細集束イオンビーム装置 (He/Ne イオン)	ZEISS “ORION NanoFab”
FA-02	多元 DC/RF スパッタ装置	キヤノンアネルバ “EB1100”

表 1B： 微細加工プラットフォーム支援提供装置 B 群

装置番号	設備(設備群)名	メーカー・機種
FB-03	超高精細電子ビームリソグラフィ装置	エリオニクス “ELS-100T”
FB-04	SEM 付集束イオンビーム装置	ZEISS “Nvision 40D with NPVE”
FB-05	深掘りエッチング装置	サムコ “RIE-400iPB-NP”
FB-06	反応性イオンエッチング装置	サムコ “RIE-10NR-NP”
FB-07	金属成膜用 RF スパッタ装置	サンヨー電子 “SVC-700LRF”
FB-08	絶縁膜成膜用 RF スパッタ装置	サンヨー電子 “SVC-700LRF”

表 1C： 微細加工プラットフォーム支援提供装置 C 群

装置番号	設備(設備群)名	メーカー・機種
FC-10	電子ビームリソグラフィ装置	JEOL “JSM6500F with Beam Draw”
FC-11	集束イオンビーム装置	日立ハイテクサイエンス “SMI2050”
FC-12	反応性イオンエッチング装置	サムコ “RIE-10NOU”
FC-13	電子ビーム蒸着装置	アルバック “UEP-2000 OT-H/C”
FC-14	マスクアライナー	ミカサ “MA-10”
FC-15	LED 描画システム	ピーエムティー “PLS-1010”
FC-16	イオンシャワーエッチング装置	エリオニクス “EIS-200ER”
FC-17	ナノインプリント装置	Obducat “Eitre 3”

表 2： 分子・物質合成プラットフォーム支援提供装置

装置番号	設備(設備群)名	メーカー・機種
S01	パルスレーザー MBE 装置 (PLD)	誠南工業 “PLO-020R”
S02	有機蒸着装置	誠南工業 “VCH-020R”
S03	原子間力顕微鏡 (AFM)	日立ハイテクサイエンス “SPI3800N/SPA-300HV”
S04	薄膜 X 線回折装置	リガク “Ultima IV”
S05	テラヘルツ分光装置	日邦プレジジョン “Pulse IRS 2000-os”
S06	フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光 “6100FV MCT-600”
S07	ナノ粒子解析装置 (ゼーターサイザー)	シスメックス “NANO-ZS”
S08	位相変調型分光エリプソメーター	堀場製作所 “UVISEL LT NIR-NNG”
S09	ICP-RF スパッタ装置 (ヘリコン型 RF スパッタ装置)	アルバック “MB02-5002”
S10	RF スパッタ装置 (マグネロン型 RF スパッタ装置)	サンヨー電子 “SVC-700LRF”
S11	電気炉	誠南工業 “ARF-30K”
S12	紫外可視分光光度計	日本分光 “V-550”
S13	反応性イオンエッチング装置	サムコ “RIE-10NR”
S14	走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ “SU9000”
S15	走査型プローブ顕微鏡 (E-sweep)	日立ハイテクサイエンス “AFM5000/AFM5300E”
S16	SIMS 付カウプマン型イオンミリング装置	伯東 “IBE-KDC75-EPD-OU-TA”
S17	接触式膜厚測定器 (膜厚計)	BURUKER “DektakXT-A”
S18	イオン化エネルギー測定装置	分光計器 “BIP-KV202GD”
S19	レーザーラマン顕微鏡	ナノフoton “RAMAN-touch VIS-NIR-OUN”
S20	レーザー照射励起電流測定装置	分光計器 “BIP-KV302K”

提出後の利用したい装置の追加は可能です (装置番号に○を追加した本ページのみの再提出で可)。

7. 競争的資金

競争的資金をご利用されている場合の競争的資金名および課題名（該当なき場合は「なし」と記入）

資金名： _____ ○○○○

課題名（任意）： _____ □□□□□□□□

（利用負担金の実際の支払い財源の問い合わせではありません。本利用が競争的資金課題の実施のための申し込みである場合にご記入ください。利用負担金の実際の支払い財源については本申込書の7ページ目にご記入ください。）

科学研究費助成事業（科研費）等が該当します。企業等の場合、行政等から助成金を得て実施している場合は該当することがあります(A-STEP等)。

8. 所属長の承認（該当の方のみ）

本プラットフォーム利用に際しては利用負担金が発生します。また利用規程・課金規程の遵守の義務を負います。民間及び学生の場合の利用申込みでは、所属長の承認を受けてください。

本支援利用申込み内容を承認し、利用に際し貴利用規程・課金規程を遵守します。
（支援利用申込者の所属長の）

所属名：ナノテクノロジープラットフォーム株式会社 開発事業部 開発1課
職名：課長
氏名：美齊 花香

美齊

9. 利用料の希望支払形態

次頁利用負担金表をご覧の上、①か②のいずれかを決定してください（いずれかに ○印）。代行料およびクリーンルーム入室料は従量制のみです（上限設定はございません）。

① 年極

② 月極または従量制（月極か従量制かは月ごとに低額料金になる方で請求します）

10. 経理担当者(大学等においては研究室の秘書など)

（すべての項目を正確に記入してください）

所属名：ナノテクノロジープラットフォーム株式会社 本社経理部

職名：係員

氏名：^{ふり} 美室 ^{がな} 剛生（ふむろ たけお）

所在地：〒aaa-bbbb

TEL：(06) mmmm - nnnn

E-mail：accounting@...

記入例のように、漢字氏名の後ろに括弧書きでふりがなを入れても構いません。

利用負担金（成果公開事業（1 課題毎））

利用料（微細加工プラットフォーム A 群）

料金制		大学・公的研究機関	民間企業等
従量制(円/4 時間)	単位	12,000	18,000
月極(円/月)	—	600,000	900,000
年極(円/年)	—	6,000,000	9,000,000

利用料（微細加工プラットフォーム B 群）

料金制		大学・公的研究機関	民間企業等
従量制(円/4 時間)	単位	8,000	12,000
月極(円/月)	—	400,000	600,000
年極(円/年)	—	4,000,000	6,000,000

利用料（微細加工プラットフォーム C 群）

料金制		大学・公的研究機関	民間企業等
従量制(円/4 時間)	単位	6,000	9,000
月極(円/月)	—	300,000	450,000
年極(円/年)	—	3,000,000	4,500,000

利用料（分子・物質合成プラットフォーム）

料金制		大学・公的研究機関	民間企業等
従量制(円/4 時間)	単位	5,000	7,500
月極(円/月)	—	50,000	75,000
年極(円/年)	—	500,000	750,000

代行料（微細加工プラットフォーム、技術代行に対して加算）

料金制		大学・公的研究機関	民間企業等
従量制(円/1 時間)	工数	2,000	3,000

代行料（分子・物質合成プラットフォーム、技術代行に対して加算）

料金制		大学・公的研究機関	民間企業等
従量制(円/1 時間)	工数	2,000	3,000

クリーンルーム入室料

料金制		大学・公的研究機関	民間企業等
月額(円/月・人)	点	1,000	1,000

- 成果非公開事業区分の料金については上記成果公開事業の 3 倍額とする（クリーンルーム入室料を除く）。
- 利用料はそれぞれの装置の群ごとに群内の装置利用時間を暦月ごとに合計し、1 単位未満の端数時間は切り上げる。
- 利用料については料金制を選択できる。
- 利用料の従量制において 1 カ月の課金額は月極額を上限とする。
- 利用料の従量制および月極の 1 年度内の課金額は年極額を上限とする。
- 代行料は利用形態で技術代行が含まれる場合に適用し、利用料とは別途従量制により加算するものとし、上限を設けない。
- 代行料はそれぞれのプラットフォームごとに支援員の代行時間を暦月ごとに合計し、1 工数未満の端数時間は切り上げる。
- **クリーンルーム入室料は産業科学研究所 N415 室、I215 室それぞれ 1 回以上の入室について適用します。**

11. 共同利用者リスト (兼大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点利用規程第 18 条 1 項に関する確認書)

フリガナ氏名	メールアドレス (携帯メール不可)	所属	職名 学生の場合は学年	保険加入	研究不正防止確認	
					日付	印
支援利用申込者 (利用責任者) ミノウ タロウ	exsample@....	ナノテクノロジープラットフォーム (株) 開発事業部 開発 1 課	研究主任	済	2017 10/6	
名野 太郎						
ミセ ハナカ						
美斉 花香	y-hirokusa@...	ナノテクノロジープラットフォーム (株) 開発事業部 開発 1 課	課長	済	2017 10/6	
ヒロクサ ヨシキヨ						
廣草 介汐						
ヤママ ノブヒロ	nobu-yama@...	ナノテクノロジープラットフォーム (株) 開発事業部 分析課	研究員	済	2018 4/6	山間
山間 宣太						
					20	/
					20	
記入例 ナノテク タロウ	nanonet@....	大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点	研究員	済	2017 10/2	印
名能手久 太郎						

継続・発展課題で昨年度から継続して共同利用する方は、押印（または署名）が不要です（最初に研究不正防止確認手続きした日付のみ記入）。

継続・発展課題の場合は、追加利用者のみ研究不正防止確認手続（日付・押印（または署名））が必要です。新規課題の場合は全員の研究不正防止確認手続（日付・押印（または署名））が必要です。

- 行が不足する場合は追加して頂いて構いません。複数ページに亘っても構いません。
- 保険加入欄について：加入済みの方は「済」と記入する（労災保険もしくは学生総合保険等が該当します）。
- メールアドレスは装置のメンテナンスのお知らせ等に使用します（装置の利用のない方は登録不要です）。
- 研究不正防止確認欄は大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点利用規程第 18 条 1 項に定められた研究不正を行わない旨の確認です。共同利用者の自筆署名または印鑑が必要です(日付も記入)。年度内に共同利用者を追加する場合は、追加したい利用者を含めた全員の名簿を再提出してください（本ページのみの再提出で結構です。確認欄については追加する利用者分のみで可）。継続および発展課題の場合、過年度に確認手続きを行った方については最初に手続きを行った日付の記入のみで可です。

大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点利用規程第 18 条(抜粋)
 利用責任者及び共同利用者は、不正行為を行ってはならない。また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
 2 前項の「不正行為」の定義は「大阪大学における公正な研究活動の推進に関する規程」における定義を準用する。

「不正行為」とは「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成 26 年 8 月 26 日文科科学大臣決定）に基づいて「大阪大学における公正な研究活動の推進に関する規程」に定めた特定不正行為（捏造、改ざん及び盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサーシップ、二重投稿等）を指します。

*申込時に必要な書類をご確認ください。

- ① 支援利用申込書 A・・・全 5 頁
 - ② 支援利用申込書 B・・・全 1 頁 (パワーポイントの別ファイル)
 - ③ 契約書作成時に必要な情報 (支援利用申込者の所属が大阪大学以外の方のみ)・・・1 頁
 - ④ ナノテクノロジー設備供用拠点利用料支払計画書 (支援利用申込者の所属が大阪大学内の方のみ)・・・1 頁
 - ⑤ 支援利用に関する覚書同意書 (支援利用申込者の所属が大阪大学以外の方のみ)
 - ⑥ 秘密保持契約同意書 (支援利用申込者の所属が大阪大学以外の方のみ)
- (③～⑥は該当者のみ)

覚書作成時に必要な情報

【対象者:大阪大学以外の利用者】

ナノテクノロジー設備供用拠点では、申込課題が採択されましたら、覚書および秘密保持契約書を取り交わし、利用者と当プロジェクトで1部ずつ保管します。

支援利用申込者の氏名 名野 太郎

覚書・秘密保持契約書を締結する方の情報 (支援利用申込者や共同利用者以外の方でも可)

1) 氏名 美斉 花香

2) 職名 課長

3) 所属住所 〒xxx-yyy 大阪府茨木市美穂ヶ丘 x 丁目 y-z

大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点 支援利用負担金支払計画書

【対象者:大阪大学所属又は大阪大学の経費で支払いの利用者】

各部局の経理担当と相談の上、下記の例に従って利用料金の支払い計画を提出してください。期間で財源を分ける、微細加工と分子・物質合成プラットフォームで財源を分ける場合は、その旨備考欄に記入してください。ここに書かれている財源のいかんにかかわらず、利用明細発行時に改めて支払い財源を照会します。希望する財源が支援利用負担金の支払いに充当可能かどうかの判断は利用者自身で行ってください。

【支援利用申込者の氏名_____】

所属 部局名	研究 代表者名	期間	支払財源	所管名 プロジェクト名	所管コード プロジェクトコード	備考
(記入例) 工学研究科	**助教	H25/4月～ H26/3月 (通年)	科研費若手 A (補助金)		A12345678	
(記入例) 産業科学研究所	**教授	H25/4月～ H25/6月 (3ヵ月) H25/7月～ H26/3月 (9ヵ月)	運営費交付金 受託研究費(JST)		1234567890 J123456789	期間で分けて別財源で 支払い希望

支援概要と利用申込要項（申込書として提出する際、本頁は提出不要）

1 支援の概要

文部科学省委託事業「ナノテクノロジープラットフォーム」により設置された大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点はナノテクノロジー関連の研究施設・装置を本学内外の研究者に供用します。本拠点では次の3つのプラットフォームから構成されます。

1. 微細構造解析
2. 微細加工
3. 分子・物質合成

2 支援の利用資格

産学官の研究者、開発者、および技術者

3 支援の形態

全ての支援は成果公開事業と成果非公開事業のいずれかに区分されます。成果公開事業で利用するためには、利用者は支援の成果を公開することと知的財産を非占有とすることに同意することとします。これ以外での利用は成果非公開事業区分となります。

利用者は利用相談の後、①機器利用、②技術代行、③技術補助、④共同研究、⑤技術相談により利用できます。なお支援内容によって、本拠点は成果非公開事業での利用とする場合や、他機関のプラットフォームや試験・研究機関等の紹介を行うことがあります。

4 支援の利用料

利用者には成果公開事業・成果非公開事業ともに所定の利用料をご負担いただきます。

5 支援開始までの流れ

- ① 利用者は、年度ごとに「支援利用申込書」・「支援の説明書」を作成し、供用拠点事務室へ提出いただきます。
- ② 供用拠点事務室は利用者の申込内容を確認し、本拠点での対応が可能ならば管理運営委員会に採択審査に付します。
- ③ 申込課題の支援可否は、本拠点内に設置する管理運営委員会により決定されます。
- ④ 申込課題採択後、本拠点と利用者は守秘義務や知的財産の取り扱いなどについて覚書を交わします。

6 支援成果の公開

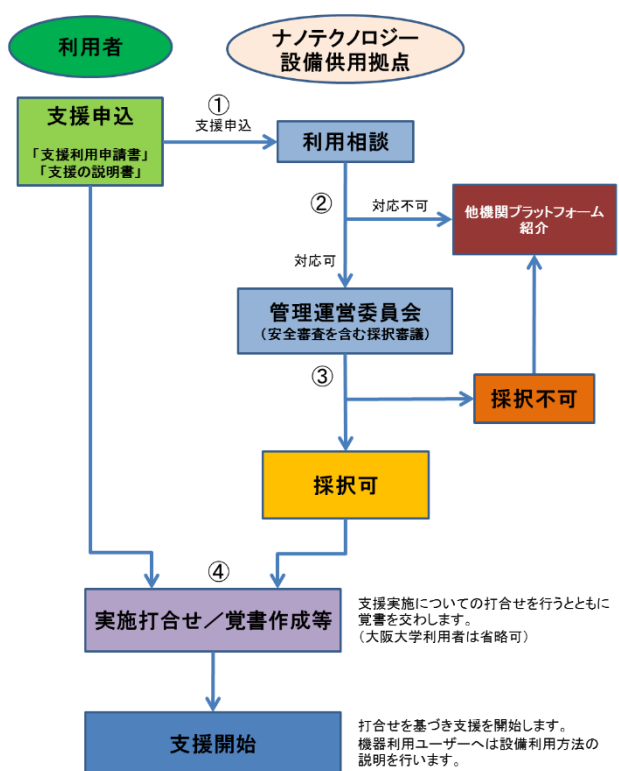
成果公開事業で支援を受けた全ての利用者は、支援終了後 60 日以内または当該年度末時点で、「ナノプラットフォーム利用成果報告書」を作成し、ご提出いただきます。また、利用者が支援結果に基づいた公表（プレス発表・論文発表・学会発表など）を行う場合は、「成果利用届」を提出するとともに公表時に以下の文面を明示してください（文字数制限等、全文を記入しきれない場合は一部簡略可）。

和文例：本成果は文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム（大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点）[課題番号]^(注)の支援を受けて実施されました。

英文例：A part of this work was supported by “Nanotechnology Platform Project (Nanotechnology Open Facilities in Osaka University)” of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan [No.:].

(注) 課題番号は本拠点より通知します。

支援開始までの流れ



2018/3/17 modify 以上